SuperKEKB 入射器用低エミッタンス・高電荷電子ビームに向けた バンチ内時間構造制御

TEMPORAL MANIPULATION OF LOW EMITTANCE AND HIGH CHARGE ELECTRON BEAM FOR SUPERKEKB INJECTION

吉田光宏^{#, A)}, 夏井拓哉^{A)}, 周翔字^{A)}, 小川雄二郎^{A)}, 杉本寬^{A)}, 飯田直子^{A)}, 臧磊^{A)}, 佐藤政則^{A)}

Mitsuhiro Yoshida ^{#, A)}, Takuya Natsui^{A)}, Xiangyu Zhou^{A)}, Yujiro Ogawa^{A)}, Hiroshi Sugimoto^{A)}, Naoko Iida^{A)},

Lei Zang^{A)}, Masanori Sato^{A)}

^{A)} High Energy Accelerator Organization (KEK)

Abstract

The KEKB injector upgrade is required to obtain the low emittance and high charge beam corresponding to the short beam life and small injection acceptance of the SuperKEKB ring. The required beam parameters are 5 nC, 20 mm mrad and 4 nC, 6 mm mrad for the electron and positron respectively. For the electron beam, we installed new photocathode RF-Gun with the focusing electric field and temporal adjusting laser system. Further the projected emittance dilution in the LINAC is an important issue for the low emittance injection. The longitudinal bunch length and shape is an important key to avoid the space charge effect and the emittance dilution. The longitudinal manipulation using the temporal adjusting laser system ,the bunch compression and the bunch flip will be required.

1. はじめに

SuperKEKB では非常に高いルミノシティーを得る ため、低エミッタンス化によるダイナミックアパー チャーの減少とビーム寿命の減少はやむを得ない。 これに対応して電子陽電子入射器も高電荷・低エ ミッタンスの電子源として、RF 電子銃の導入を進 めている。KEKB-HER への電子入射の要求は、5nC の電荷において Y 方向の規格化エミッタンスが 20mm・mrad、エネルギー分散も 0.1%である。RF 電子銃からのビームは 5nC の電荷では、20ps で 6mm・mrad のエミッタンスが最適であり、このビー ムを途中の輸送系等も含めて入射の要求値を満たさ ねばならない。加速管の横方向ウェーク場による横 方向の射影エミッタンスの増加はバンチ長が短い程 小さくできるが、縦方向ウェーク場によるエネル ギー分散は 10ps 程度が最適である。これらを満た すような条件として、時間方向のバンチ構造をレー ザーの時間構造の制御によりガウシアン分布ではな く矩形波にし、全幅で 20ps を 10ps に圧縮した後、 ビームを 1.6GeV のアーク部まで輸送し、アーク部 でさらに 4ps に圧縮する事を検討している。さらに 4ps に圧縮するとエネルギー分散が大きくなるため、 時間反転を行う検討を行った。これらのレーザーの 時間構造制御及びビームオプティックスによる時間 構造制御が重要となる。

2. 要求性能

SuperKEKB の入射に必要な電子ビームの要求性 能は表1に示す通りである。KEKB 運転時と比較す るとバンチ電荷は5倍で、エミッタンスは 20mm・ mrad が必要である。さらに HER ではシンクロトロ ン入射を採用しており、0.1% のエネルギー分散が 必要である。

	KEKB(e ⁺ /e ⁻)	SuperKEKB(e ⁺ /e ⁻)
Beam Energy	3.5 / 8.0 GeV	4.0 / 7.0 GeV
Bumch Charge	1.0 / 1.0 nC	4.0 / 5.0 nC
Normalized vertical Emittance (10)	2100 / 300 mmmrad	6 / 20 mm mrad
Energy Spread	0.1 %	0.1 %

3. 横方向及び縦方向ウェーク場の相関

ビームの軌道を適切の調整した後、5nC の高電荷 では、横方向エミッタンスの増加の主な原因となっ ているのは加速管のミスアラインメントによる横方 向ウェーク場である。またエネルギー分散は縦方向 ウェークと RF の位相によって決まる。横方向 ウェーク場を減らすには、アラインメントと短いバ ンチ長が重要である。しかし短いバンチ長は強い縦 方向ウェーク場を誘起し、エネルギー分散が大きく なる。従って横方向エミッタンスとエネルギー分散 の要求の双方を満たすには、バンチ長を的確に選択 する事が重要となる。

[#] mitsuhiro.yoshida@kek.jp



Figure 1: KEKB Injector upgrade to obtain the low emittance and the high charge for SuperKEKB injection.

3.1 横方向エミッタンス

図1は横方向の投影エミッタンスをいくつかのバ ンチ長やアラインメントエラーに対して解析的に計 算してものである。要求されたエミッタンス増加に 抑えるためには、アラインメントエラーが 0.3mm と 0.1mm のそれぞれのケースの場合、バンチ長とし て 4ps または 10ps 以下が必要となる。



Figure 2: Transeverse emittance for difference bunch length and alignment error.

3.2 初期オフセット

ビームに初期オフセットを加える事で、横方向 ウェークによるエミッタンス増加の影響を補正する 事ができる。初期オフセットとしてはベータトロン 位相が 90°異なる2つのステアリングを使用する。 図3は初期オフセットのスキャンによりエミッタン スを最適化した結果である。これを現実の加速器で 実現するにはウェーク場の影響をモニターする必要 があり、このためには RF ディフレクターによるバ ンチスライスのビーム形状モニターが有効である。



Figure 3:Initial offset to optimize the projected emittance.

3.3 縦方向ウェークによるエネルギー分散

5 nC の高電荷では、縦方向ウェークの影響が大きくなり、バンチが短くなるとRFの位相を傾けてもエネルギー分散を要求値まで小さくできなくなる。



Figure 4: Energy spread vs bunch length.

そこで時間方向の分布をガウシアンから矩形波に する事で、図4のように大幅にエネルギー分散を減 らす事ができる。

4. バンチの時間構造制御

短いバンチは横方向エミッタンスの増加を抑える が、一方で縦方向ウェークが強くなり、それを補償 するためには RF 位相を傾きのある方へずらす必要 があり、これは加速電圧の低下につながる。これを 抑えるには、バンチの時間構造を矩形にし、バンチ 長を適切に選ぶ必要がある。さらに短いバンチ長で エネルギー分散を小さくするには、バンチの時間反 転をするという事も検討している。

4.1 フォトカソード用レーザー

レーザーシステムに関しても、目標のエネルギー 分散を得るには時間方向に矩形波のパルス形状が必 要で、周波数領域制御により時間方向制御を行う。

レーザーの安定化には半導体励起が必須であり、 効率を考慮すると Nd 系か Yb 系の媒質が候補とな る。Nd 系は増幅が簡単であり高出力も得やすいが、 帯域が狭く周波数領域の制御が難しく、Chriped Pulse Amplification (CPA)も難しいため、結晶断面積 に対する出力限界がある。Yb 系は帯域が広く周波 数領域の制御やが容易であり、CPA が簡単に可能で あるため原理的にはレーザー密度を非常に高くでき るが、Yb の吸収があるため高密度の励起が必要で、 増幅が多段になりシステムとして複雑になる。

RF 電子銃用のレーザーとしては試験用には Nd 系の媒質を選択し、3-2 ユニットに導入して DAW 型 RF 電子銃と組み合わせて試験を行った。また A-1 RF 電子銃では Yb 系のファイバーレーザーとディ スクレーザーを導入しビーム試験を行っている。

4.2 シケイン

RF 電子銃からの電子ビームのエミッタンスを要 求値より十分に小さい 6 mm・mrad 程度で生成しよ うとすると、空間電荷からバンチ長は 20ps 程度に なる。しかし 20ps では横方向ウェークの影響もエ ネルギー分散も大きすぎるため、シケインで 10ps に圧縮する。

4.3 J-ARC でのバンチ圧縮

J-ARC は 1.6GeV に位置し、アイソクロナスで使 用されていたが、これをアクロマティックに設定し、 残りの加速管のアラインメントエラーの要求値を少 しでも緩和するために、バンチ圧縮を行う。例えば 4ps に圧縮した場合には必要なアラインメント精度 が 0.3mm 程度になる。

4.4 バンチ反転

短いバンチは横方向エミッタンスの増加を抑制で きるが、縦方向のウェーク場が強くなり、4ps より 短くなると、これをSバンドのRFのスロープでは 補償できなくなる。C~5セクターの計6セクター の丁度中間には第二スイッチヤード(SY2)があり、 SuperKEKBの増強ではここにダンピングリングへの 輸送路があるため、電子が逆側のシケインを通過す る。図5のように、シケインのQ磁石の設定を変更 し、直線部でのシングルキックを利用してディス パージョンを発生させる事ができれば、図6のよう に負の R₅₆と自らの縦方向ウェークによるエネル ギーの傾きを利用してバンチが反転できる。



Figure 5: Longitudinal wakefield cancellation.

5. バンチ形状の測定系

以上のようにバンチの時間構造制御がエミッタン ス保存やエネルギー分散の実現において重要である。 時間構造を測定するには現在は 2ps 分解能のスト リークカメラを使用しているが、今後XバンドのR Fディフレクターをインストールし、バンチの形状 をバンチスライスで観測しつつ、調整を行う。

6. まとめ

SuperKEKB 入射器において高電荷・低エミッタン スビームの輸送には時間構造制御が有効であり、こ のためのレーザー、ビーム光学、診断系等の開発を 行っている。

参考文献

- [1] T. Natsui et al., "Quasi Traveling Wave Side Couple RF Gun for SuperKEKB", TUOCB103, IPAC13, Shanghai, China, proceedings of this conference.
- [2] X.Zhou, et al., "Ytterbium Laser Development of DAW RF Gun for SuperKEKB", WEPME018, IPAC13, Shanghai, China, proceedings of this conference.
- [3] Tor O. Raubenheimer, "The Generation and Acceleration of Low Emittance Flat Beams For Future Linear Colliders", SLAC-R-387
- [4] LCLS CDR Chapter 7 Accelerator
- [5] Karl L. F. Bane, "Wakefield Effects in a Linear Collider", Proceedings of the U.S. Summer School on High Energy Particle Accelerators, Batavia, Illinois, Aug. 13-31, 1984.
- [6] J. Wang, "X-Band Deflectors Development at SLAC", X-Band RF Structure and Beam Dynamics Workshop - 44th ICFA Advanced Beam Dynamics Workshop, December 2008